

GVC-5000 多功能镀膜仪



- 双组件设计：磁控溅射组件+热蒸发组件，可镀金属膜和碳膜
- 两种模式一键切换，无需更换组件
- 一键操作，全自动控制，操作非常简单
- 具有防污染设计，避免工作时相互污染
- 加热方式：连续&脉冲，可精确控制碳膜厚度
- 颗粒度小、无损伤，适配各种型号扫描电镜和样品

主要参数

外形尺寸	424(L)×330(D)×335(H)mm	操作界面	7英寸触摸屏、全数字显示
溅射靶材	金、铂、银、铜、铈等	靶材尺寸	φ57mm×0.12mm
溅射电流	5-100mA	溅射时间	0-999s 连续可调
蒸发源	φ0.8mm 碳纤维 或 φ0.5mm 碳棒（无需磨削）	蒸发源数量	1-4
蒸发模式	连续模式、脉冲模式	蒸发源状态	自动检测、显示、使用
真空室	高硅硼玻璃φ200×130mm	工作介质	空气或者氩气
真空泵组	旋片式真空泵	真空泵抽速	1.1L/s
极限真空	≤1Pa	抽气节拍	≤3分钟
工作真空	镀碳≤2Pa 镀金：4-20Pa	样品台	Max. φ125mm
样品台旋转	手动、自动	样品台转速	高、低两档可调
预溅射	具备预溅射挡板，全自动控制		
保护功能	过流保护、真空保护、分子泵过热保护等		
防污染	具备防污染结构，防止自控溅射组件与热蒸发组件交叉污染		
膜厚仪 (选配)	可实时显示镀膜厚度，并通过设定来控制镀膜过程，最优测量精度 0.1nm，单次镀膜设定范围1-999nm，最大测量范围10μm		